



SAH

H60-088US

4
10-31-02

SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT
CONFÉDÉRATION SUISSE
CONFEDERAZIONE SVIZZERA



Bescheinigung

Die beiliegenden Akten stimmen mit den ursprünglichen technischen Unterlagen des auf der nächsten Seite bezeichneten Patentgesuches für die Schweiz und Liechtenstein überein. Die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein bilden ein einheitliches Schutzgebiet. Der Schutz kann deshalb nur für beide Länder gemeinsam beantragt werden.

Attestation

Les documents ci-joints sont conformes aux pièces techniques originales de la demande de brevet pour la Suisse et le Liechtenstein spécifiée à la page suivante. La Suisse et la Principauté de Liechtenstein constituent un territoire unitaire de protection. La protection ne peut donc être revendiquée que pour l'ensemble des deux Etats.

Attestazione

Gli uniti documenti sono conformi agli atti tecnici originali della domanda di brevetto per la Svizzera e il Liechtenstein specificata nella pagina seguente. La Svizzera e il Principato di Liechtenstein formano un unico territorio di protezione. La protezione può dunque essere rivendicata solamente per l'insieme dei due Stati.

Bern, 24 Okt. 2000

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

Patentverfahren
Administration des brevets
Amministrazione dei brevetti

Rolf Hofstetter
Rolf Hofstetter

Patentgesuch Nr. 1998 1269/98

HINTERLEGUNGSBESCHEINIGUNG (Art. 46 Abs. 5 PatV)

Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum bescheinigt den Eingang des unten näher bezeichneten schweizerischen Patentgesuches.

Titel:
Verfahren zum Entschichten von Hartstoffschichten.

Patentbewerber:
BALZERS HOCHVAKUUM AG

9477 Trübbach

Vertreter:
Troesch Scheidegger Werner AG
Siewerdtstrasse 95 Postfach
8050 Zürich

Anmeldedatum: 11.06.1998

Voraussichtliche Klassen: C23F

Verfahren zum Entschichten von Hartstoffschichten

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Entschichten von Hartstoffschichten ausser aus TiN von Hartmetallsubstraten.

- 5 Aus der DE 43 39 502 ist es bekannt, als Hartstoffschichten Duplexschichten aus TiN/TiAlN von Hartmetallsubstraten mittels komplex zusammengesetzter Lösungen auf Wasserstoffperoxidbasis zu entschichten.

- 10 Die gemäss der DE 43 39 502 eingesetzte Lösung für das Entschichten von TiN/TiAlN-Duplexhartstoffschichten genügt wohl den Forderungen nach kurzen Entschichtungszeiten und bezüglich Durchführbarkeit nur wenig über Zimmertemperatur. Aufgrund ihrer komplexen Zusammensetzung genügt sie aber nicht den Forderungen nach einfacher Entsorgung. Zudem führen die eingesetzten
15 Lösungen, welche unterschiedslos die TiN- und TiAlN-Schichten auflösen, zu einer nichttolerablen Beeinträchtigung der Hartmetallsubstratoberfläche. Die eingesetzten Lösungen sind teuer.

- Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die obengenannten Nachteile zu beheben und ein Entschichtungsverfahren für Hartstoffschichten vorzuschlagen, welches einerseits die Vorteile
20 der aus der DE 43 39 502 bekannten Verfahren beibehält, nämlich bezüglich kurzer Entschichtungszeiten und Entschichtungstemperatur, aber zudem die Hartmetallsubstratoberfläche weit weniger beeinträchtigt, einfach in der Lösungszusammensetzung und ent-
25 sorgungsfreundlicher ist.

Dies wird erfindungsgemäss dadurch erreicht, dass man zwischen Substrat und Hartstoffschicht eine TiN-Zwischenträgerschicht aufbringt und die Hartstoffschicht durch selektives Lösen, wei-

testgehend nur der TiN-Schicht, nämlich durch Poren der Hartstoffschicht hindurch, entfernt.

Erfindungsgemäss wurde erkannt, dass, wenn das Bestreben nicht dahin geht, die Hartstoffschicht selber zu lösen, sondern dahin, zwischen Hartmetallsubstrat und Hartstoffschicht eine Zwischenträgerschicht vorzusehen, deren Auflösung wesentlich einfacher ist als die Auflösung der Hartstoffschicht an sich, indem die insbesondere bei PVD-aufgebrachten Hartstoffschichten immer vorhandene Porösität dazu führt, dass diese Schicht durch die Lösung unterwandert und die Zwischenträgerschicht aufgelöst wird. Dies führt zum Abfallen der nicht oder wesentlich weniger gelösten Hartstoffschicht.

In einer bevorzugten Ausführungsform des Verfahrens werden Hartstoffschichten, welche eine Schicht des Types

(E₁, E₂ ... E_n)X

umfassen, entschichtet, worin bedeuten:

E_x: Element Nr. n = x aus einer der Gruppen IVA, VA, VIA des Periodensystems (Römp, Chemielexikon)

X: mindestens ein Element der Gruppe N, C, O

n: Laufparameter.

Die Dicke der Zwischenschicht wird dabei wesentlich geringer gewählt als diejenige der funktionellen Hartstoffschicht. Bevorzugterweise wird die Zwischenschichtdicke d_z wie folgt gewählt:

$$0,01 \mu\text{m} \leq d_z \leq 0,5 \mu\text{m},$$

vorzugsweise $0,01 \mu\text{m} \leq d_z \leq 0,3 \mu\text{m}$,

insbesondere bevorzugt

$0,01 \mu\text{m} \leq d_z \leq 0,2 \mu\text{m}$.

In einer weiter bevorzugten Ausführungsform des erfindungsge-
5 mässen Verfahrens umfassen die Elemente E_x - mit $1 \leq x \leq n$ - Al
und/oder Si und/oder Cr. In einer weiteren bevorzugten Ausführ-
ungsform des erfindungsgemässen Verfahrens umfasst die Hart-
stoffschicht eine CrC-, CrN-, CrCN- oder eine WC-C-Schicht. In
einer insbesondere bevorzugten Ausführungsform ist die Hart-
10 stoffschicht eine Schicht des Types

$(E_1, E_2)X$.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform des erfindungsge-
mässen Verfahrens umfasst die Hartstoffschicht eine TiAlN-
und/oder TiCrN-Schicht, wobei in einer ganz besonders bevorzug-
15 ten Ausführungsform die Hartstoffschicht eine TiAlN-Schicht um-
fasst, dabei, insbesondere bevorzugt, eine TiAlN-Schicht ist.

Die Hartstoffschicht weist bevorzugterweise eine Schichtdicke
von mindestens $2 \mu\text{m}$ auf.

Als Lösung wird bevorzugterweise eine Wasserstoffperoxidlösung
20 eingesetzt, dabei bevorzugt mit höchstens 50 Gew.% Wasserstoff-
peroxid, insbesondere bevorzugt mit höchstens 20 Gew.% Wasser-
stoffperoxid. In diese Lösung wird bevorzugterweise weiter NaOH
zugegesetzt, dies bevorzugt mit höchstens 5 Gew.%, insbesondere
bevorzugt mit höchstens 0,5 Gew.%.

25 Dabei wird weiter bevorzugt der Lösung mindestens einer der
Stoffe Di-Natriumoxalat, K-Na-Tartrat-Tetrahydrat zugefügt,

dies vorzugsweise mit höchstens 5 Gew.%, insbesondere bevorzugt mit höchstens 0,5 Gew.%. In einer ganz besonders bevorzugten Ausführungsform umfasst die eingesetzte Lösung, ausser Wasser, ausschliesslich Wasserperoxid, bevorzugt mit den angegebenen 5 Gew.%, sowie NaOH, ebenfalls bevorzugt mit den angegebenen Gew.%, sowie mindestens eines der erwähnten Stoffe Di-Natriumoxalat, K-Na-Tartrat-Tetrahydrat, ebenfalls bevorzugt in der angegebenen Konzentration.

Beispiele:

- 10 Es wurden Hartmetall-Wendeschneidplatten mit einem Schichtpaket TiN/TiAlN beschichtet. Die TiN-Zwischenschicht wies eine Dicke von 0,5 µm auf, die Gesamtdicke des Paketes betrug 4 µm.

Variante 1:

In einer Lösung: - H₂O₂ : 17,5 Gew.%

- 15 - Di-Natriumoxalat: 2,5 Gew.%

- NaOH: 0,25 Gew.%

wurde bereits 10 min. nach Einbringen der beschichteten Substrate in die Lösung, bei 50°C, der Beginn des Entschichtungsvorganges sichtbar. Es lösten sich Hartstoffschichtstücke 20 mit einer Grösse bis zu 30 mm² ab. Nach zwei Stunden waren die Substrate vollständig entschichtet, ohne jegliche Beeinträchtigung der Hartmetallsubstratoberfläche.

Variante 2:

Die obengenannten beschichteten Hartmetallwendeschneidplatten 25 wurden in einer Lösung:

- H_2O_2 : 17,5 Gew.%

- K-Na-Tartrat-Tetrahydrat: 2,5 Gew.%

- NaOH: 0,1 Gew.%,

bei 30°C entschichtet.

- 5 Wiederum war bereits nach 10 min. der Beginn des Entschichtungsvorganges sichtbar. Abgelöste Hartstoffschichtstücke waren klar in der Entschichtungslösung erkennbar. Nach 2 Std. waren die Wendeschneidplatten ohne jegliche Beeinträchtigung der Hartmetallsubstratoberfläche entschichtet.
- 10 Es ist ersichtlich, dass das erfindungsgemäße Verfahren bereits bei relativ tiefen Lösungstemperaturen höchst zufriedenstellend wirkt, bei Temperaturen z.B. im Bereich von 20°C bis 60°C.

Patentansprüche:

1. Verfahren zum Entschichten von Hartstoffschichten ausser aus TiN von Hartmetallsubstraten, dadurch gekennzeichnet, dass man zwischen Hartmetallsubstrat und Hartstoffschicht eine TiN-Zwischenschicht aufbringt, und dass man die Hartstoffschicht durch selektives Auflösen der TiN-Schicht durch Poren der Hartstoffschicht hindurch entfernt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Hartstoffschicht eine Schicht des Typs umfasst

10 $(E_1, E_2 \dots E_n)X,$

mit

E_x : Element Nr. $n = x$ aus einer der Gruppen IVA, VA, VIA des Periodensystems (Römpp, Chemielexikon)

X: mindestens ein Element der Gruppe N, C, O

15 n: Laufparameter.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass man die Schichtdicke der Zwischenschicht (d_z) wie folgt wählt:

$$0,01 \mu\text{m} \leq d_z \leq 0,5 \mu\text{m},$$

vorzugsweise $0,01 \mu\text{m} \leq d_z \leq 0,3 \mu\text{m},$

20 vorzugsweise $0,01 \mu\text{m} \leq d_z \leq 0,2 \mu\text{m}.$

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Elemente E_x ($1 \leq x \leq n$) Al und/oder Si und/oder Cr umfassen.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Hartstoffschicht eine CrC-, CrN-, CrCN- oder WC-C-Schicht umfasst, vorzugsweise ist.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Hartstoffschicht eine Schicht des Typs

$$(E_1, E_2)X$$

umfasst, vorzugsweise ist.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Hartstoffschicht eine TiAlN- und/oder TiCrN-Schicht umfasst.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Hartstoffschicht eine TiAlN-Schicht umfasst, vorzugsweise eine TiAlN-Schicht ist.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Hartstoffschicht eine Dicke von mindestens 2 μm aufweist.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass man als Lösung eine Wasserstoffperoxidlösung einsetzt, vorzugsweise mit höchstens 50 Gew.% Wasserstoffperoxid, insbesondere bevorzugt mit höchstens 20 Gew.% Wasserstoffperoxid.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass man der Lösung NaOH zusetzt, vorzugsweise mit höchstens 5,0 Gew.%, vorzugsweise mit höchstens 0,5 Gew.%.

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass man der Lösung mindestens eines der Stoffe Di-

Natriumoxalat, K-Na-Tartrat-Tetrahydrat zugefügt, vorzugsweise mit höchstens 5 Gew.%.
5

13. Verfahren nach Anspruch 10, 11 und 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Lösung ausser Wasser ausschliesslich die erwähnten Substanzen aufweist.

